

เอกสารอ้างอิง

1. Runyan, W.R. in Semiconductor Measurements and Instrumentation p.p. 21-35, McGRAW-HILL KOGAKUSHYA, LTD., Tokyo, 1975.
2. อาเรีย วิเชียรฉาย. "ผิวสัมผัสสร้างโดยวิธีขูบนีเกลและทองแดงบนเซลล์แสงอาทิตย์ และหัวรัดรังสีอัลฟ่า" วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ ปัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
3. บรรยง ໂຕປະເສົ້າພັນ, ສມສັກ ປູ້ຄູ່ແກ້ວ. "ການທຳຜິວສັນຜົສ Ni/n-Si ໃຫ້ເປັນໂອໜົມມີຄໂດຍເຖົງການໃຊ້ເຄືອງການຂູບນີ້ເກີລແບບໄຣຟຟັ້ງ" ການປະຊຸມທາງວິຊາການວິສະວະຮົມໄຟຟັ້ງ ຄັ້ງທີ 4 ຂອງການວິສະວະຮົມໄຟຟັ້ງ 8 ສາດັບອຸດນະກິາ ເລີ່ມ 1
4. Young, R.T., Wood, R.F., Narayan, J., White, C.W. and Chistic, W.H. "Plused laser techniques for solar cell processing" IEEE Transactions on Electron Devices. 27(4), (1980) : 807-814.
5. Grum, F. and Becherer, R.J. in Optical Radiation Measurement. vol.1 p.p.261-269, Academic Press, New York, 1979.
6. Martinich, S.J., Johnson, C.J. and Akitt, D.P. "Measurement of far-infrared laser power" The Review of Scientific Instrument. 40(2), (1969) : 359-360.
7. Jennings, D.A., and West, E.D. "A laser power meter of large beam" The Review of scientific instrument. 41(4), (1970) : 565-567.
8. Offenberger, A.A. "Analytic of a thermocouple laser power meter" Applied Optics. 9(11), (1970) : 2594-2597.
9. Schmidit, L.B., and Case, W.E. "Comparison of the laser power and total irradiance scales maintained by the National Bureau of Standards" Applied Optics. 12(11), (1973) : 2773-2776.
10. Brown, W.L. "Superfast annealing" IEEE Spectrum. 4(1981) : 50-54.
11. Young, R.T., and Narayan, J. "Laser annealing of diffusion-induced imperfection in silicon" Applied Physics Letters. 33(1), (1978) : 14-15.

12. Lau, S.S., Tseng, W.F., Nicolet, M-A., and Mayer, J.W., "Epitaxial growth of deposited amorphous layer by laser annealing" Applied Physics Letters, 33(2), (1978) : 130-131.
13. Affolter, K., Lüthy, W., and Von Allmen, M. "Properties of laser-assisted doping in silicon" Applied Physics Letters, 33(2), (1978) : 185-187.
14. Charschan, S.S. in Laser in industry p.p. 24, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1972.
15. Young, R.T., White, C.W., Clark, G.J., Narayan, J. Christie, W.H., Murakami, M., King, P.W., and Kromer, S.D. "Laser annealing of boron-implanted silicon" Applied Physics Letters. 32(3), (1978) : 139-141.
16. Gat, A., and Gibbon, J.F., "A laser apparatus for annealing of ion-implantation damage in semiconductor" Applied Physics Letters. 32(3), (1978) : 142-143.
17. Celler, G.K., Poate, J.M., and Kimerling, L.C., "Spatially controlled crystal regrowth of ion-implanted silicon by laser irradiation" Applied Physics Letters. 32(8), (1978) : 464-466.
18. Muller, J.C., Fogarassy, E., Salles, D., Stuck, R., and Siffert, P.M. "Laser processing in the preparation of silicon solar cells" IEEE Transactions on Electron Devices. 27(4), (1980) : 815-821.
19. Young, R.T., and Wood, R.F. "Laser processing for high silicon solar cells" Journal of Applied Physics. 53(3), (1982) : 1178-1188.
20. Bae, M.S., and D'Aiello, R.V. " P^+ /N high-efficiency silicon solar cells" Applied Physics Letters. 31(5), (1977) : 285-287.
21. Woodall, J.M., and Hovel, H.J., "An isothermal etchback-regrowth method for high-efficiency $Ga_{1-x}Al_xAs$ -GaAs solar cell" Applied Physics Letters. 33(9), (1978) : 800-802.

22. Narayan, J., Young, R.T., and Wood, R.F. "P-N junction formation in boron deposited silicon by laser-induced diffusion" Applied Physics Letters. 33(4), (1978) : 338-340.
23. Stuck, R., Fogarassy, E., Muller, J.C., Hodeau, M., Wattiaux, A., and Siffert, P. "Laser-induced diffusion by irradiation of silicon into an organic solution of the dopant" Applied Physics Letters. 38(9), (1981) : 715-717.
24. Oraby, A.H., Murakmi, K., Yuba, Y., Gamo, K., and Namba, S. "Laser annealing of ohmic contacts on GaAs" Applied Physics Letters. 38(7), (1980) : 562-563.
25. Smit, L., De Jong, T., Hoonhout, D., and Saris, F.W. "Silicon molecular beam epitaxy on arsenic-implanted and laser-processed silicon" Applied Physics Letters. 40(1), (1982) : 64-66.
26. Wittmer, M., Lüfhy, W., Sluder, B., and Melchior, H. "Electrical Characteristics of laser-contacted diode" Solid-state Electronics. 24(3), (1981) : 141-144.
27. Han-Sheng Lee. "The field effect electron mobility of laser-annealed polycrystalline silicon MOSFETS" Solid-State Electronics. 24(11), (1981).
28. บุญมาก ศรีเนาว์กุล. "การวิเคราะห์กระแสไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์แบบหัวต่อฟี-เอ็น" วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
29. ประมวล วงศ์ภูวा. "การศึกษาและการใช้แอนโนดิออกซิเดชันเพื่อหาอิมเพียร์เรสต์โปรดไฟฟ์" วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.

ภาคผนวก ก.



ทฤษฎีเลเซอร์

เลเซอร์ (laser) เป็นแหล่งที่กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเพريยบพร้อม (Coherent electromagnetic wave) แสงเลเซอร์นี้มีคุณสมบัติดังนี้

- 1). มีความเพรียบพร้อม (Coherency) คลื่นที่ปลดปล่อยออกมานะจะมีผลเด่นกัน
- 2) มีทิศทางแน่นอน (Directional) ไปตามทิศทางของแกนอปติก (Optical axis)
และเป็นลักษณะ
- 3) ใช้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดียว (Single wavelength)
- 4) มีความเข้มสูง (High intensity) เพราะเป็นการปลดปล่อยพลังงานแสงในพื้นที่หน้าตัดแคบๆ จึงทำให้มีความเข้มสูงกว่าแสงธรรมชาติที่กระจายจากจุดกำเนิดทุกทิศทาง

การสร้างเลเซอร์นั้นสามารถทำได้โดย การกระตุ้นตัวกลางเลเซอร์ (Laser medium) ซึ่งอาจเป็นอิオン (Ion) อะตอม (Atom) หรือโมเลกุล (Molecule) ให้ขึ้นไปอยู่ในสภาวะกระตุ้น (Excited state) และค้างอยู่ในสภาวะนั้นเนื่องจากมีอายุชีวิตที่ยาวมาก และไม่ตกลงไปยังสภาวะเดิม สภาวะนี้เรียกว่า Metastable state การที่ทำให้อิออน อะตอม หรือโมเลกุล ของตัวกลางเลเซอร์ขึ้นไปอยู่ในสภาวะถูกกระตุ้นแล้วค้างอยู่นั้น จะทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่า Population inversion ขึ้น ตือเมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้จำนวน อิออน อะตอม หรือโมเลกุลที่อยู่ในสภาวะปกติ (Ground state) ปรากฏการณ์นี้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการทำให้เกิดแสงเลเซอร์ (Lasing) สมการแสดงอัตราส่วนของ อิออน อะตอม หรือโมเลกุล ที่สภาวะปกติเป็นไปดังนี้

$$\frac{N_n}{N_m} = \exp \left(-\frac{E_n - E_m}{kT} \right) \quad \dots \dots (1)$$

เมื่อ k = ค่าคงที่ของ Boltzmann ($1.3806 \times 10^{-23} \text{ J}/\text{°K}$)

T = อุณหภูมิสัมบูรณ์

E_m = พลังงานที่สภาวะถูกกระตุ้น

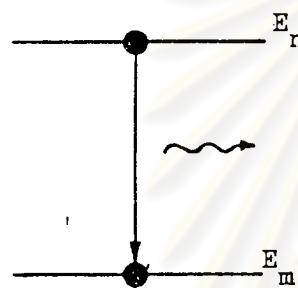
E_n = พลังงานที่สภาวะปกติ

จากสมการที่ (1) เมื่อแทนค่า k, T, E_n และ E_m ของตัวกลางเลเซอร์เข้าไปจะพบว่า ที่อุณหภูมิปกติอัตราส่วน N_n/N_m มีค่าน้อยมาก นั่นคือ อิオน อะตอม หรือโมเลกุลส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาวะปกติ

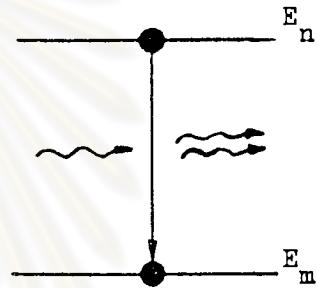
การทดลองมาสภาวะปกติจากสภาวะถูกกระตุ้น และปลดปล่อยพลังงานออกมายโดยธรรมชาติจะ

มี 2 แบบ คือ

- 1) การปลดปล่อยที่เกิดได้เอง (Spontaneous emission) เกิดขึ้นเมื่อ อิอัน อะตอม หรือโมเลกุลถูกกระตุ้นให้ขึ้นไปอยู่ในสภาวะถูกกระตุ้นจนหมดอายุชีวิตแล้วก็ตกลงมาอยู่ สภาวะปกติ โดยปลดปล่อยพลังงานออกมาย



การปลดปล่อยที่เกิดได้เอง



การปลดปล่อยที่เกิดจากการเร้า

รูปที่ 1

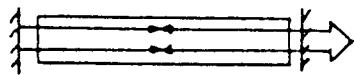
- 2) การปลดปล่อยที่เกิดจากการเร้า (Stimulated emission) เกิดขึ้นโดยการที่มี โฟตอน ซึ่งมีพลังงานเท่ากับพลังงานแตกต่างระหว่างสภาวะถูกกระตุ้น และสภาวะปกติ ($E_n - E_m$) เข้ามาเร้าทำให้เกิดการตกลงจากสภาวะถูกกระตุ้นมาอยู่สภาวะปกติ และปลดปล่อยพลังงานออกมายเป็นโฟตอนที่มีพลังงานและเพลเท่ากับโฟตอนที่เร้า ทำให้ได้โฟตอนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการขยาย (Amplification) จำนวนโฟตอน

จากการที่เกิด Population inversion ขึ้นและตัวกลางเลเซอร์มี Metastable state นั้น เมื่อมีบางอิオน อะตอม หรือโมเลกุลตกลงมาได้เองจะปลดปล่อยโฟตอนออกมามีค่า เท่ากับผลต่างของระดับพลังงานของสภาวะถูกกระตุ้นกับสภาวะปกติ โฟตอนนี้จะร่วงไปในตัวกลางเลเซอร์ไปเร้า อิอัน อะตอม หรือโมเลกุลที่ถูกกระตุ้นและอยู่ใน Metastable state ทำให้เกิด การตกลงแบบเร้าและปลดปล่อย โฟตอนที่มีพลังงานเท่ากับพลังงานของโฟตอนที่ขึ้น ทำให้เกิดโฟตอนที่มีพลังงานและเพลเท่ากันเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมากสะท้อนกับกระจกเงา (Mirror) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Optical cavity) และสะท้อนกลับเข้ามาในตัวกลางเลเซอร์อีก เป็นการไปกระตุ้นให้เกิดการตกลงแบบเร้ามากขึ้น ทำให้ได้โฟตอนมากขึ้น โฟตอนนี้จะสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่

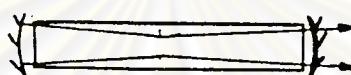
ระหว่างกระจากเงาทั้ง 2 แผ่นที่วางตั้งฉากกับแนวแกนทางแสง ทำให้เกิดโพดอนมากขึ้นตามลำดับ แสงส่วนหนึ่งจะทะลุผ่านออกจากการอปติกคอลแลร์ติ ทางด้านที่มีกระจากกึ่งทะลุกึ่งสะท้อน (Partially transmission & reflection mirror) เป็นแสงเลเซอร์ในที่สุด

Optical cavity ที่นิยมใช้กันมี 3 แบบ คือ

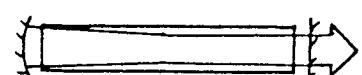
- 1) แบบกระจากเงานาน (Plane Parallel)
- 2) แบบโฟกัสร่วม (Confocal)
- 3) แบบกึ่งกระจากเงากับแบบกระจากเว้า (Hemispherical)



แบบที่ 1

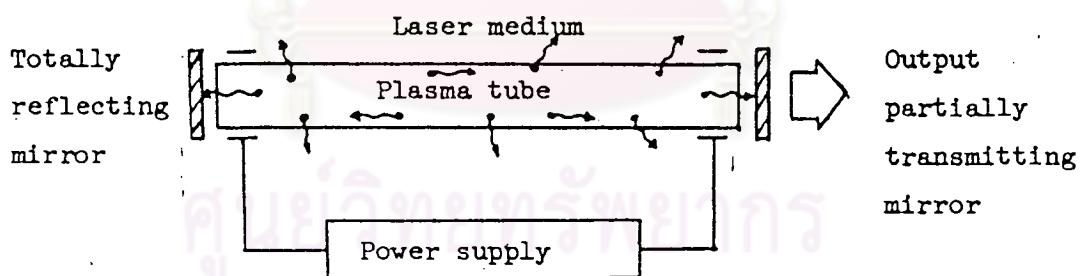


แบบที่ 2



แบบที่ 3

Optical cavity ทั้ง 3 แบบนี้มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับระบบที่ต้องการ เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงโครงสร้างของระบบเลเซอร์ได้ดังนี้



รูปที่ 3 แผนภาพโครงสร้างของระบบเลเซอร์

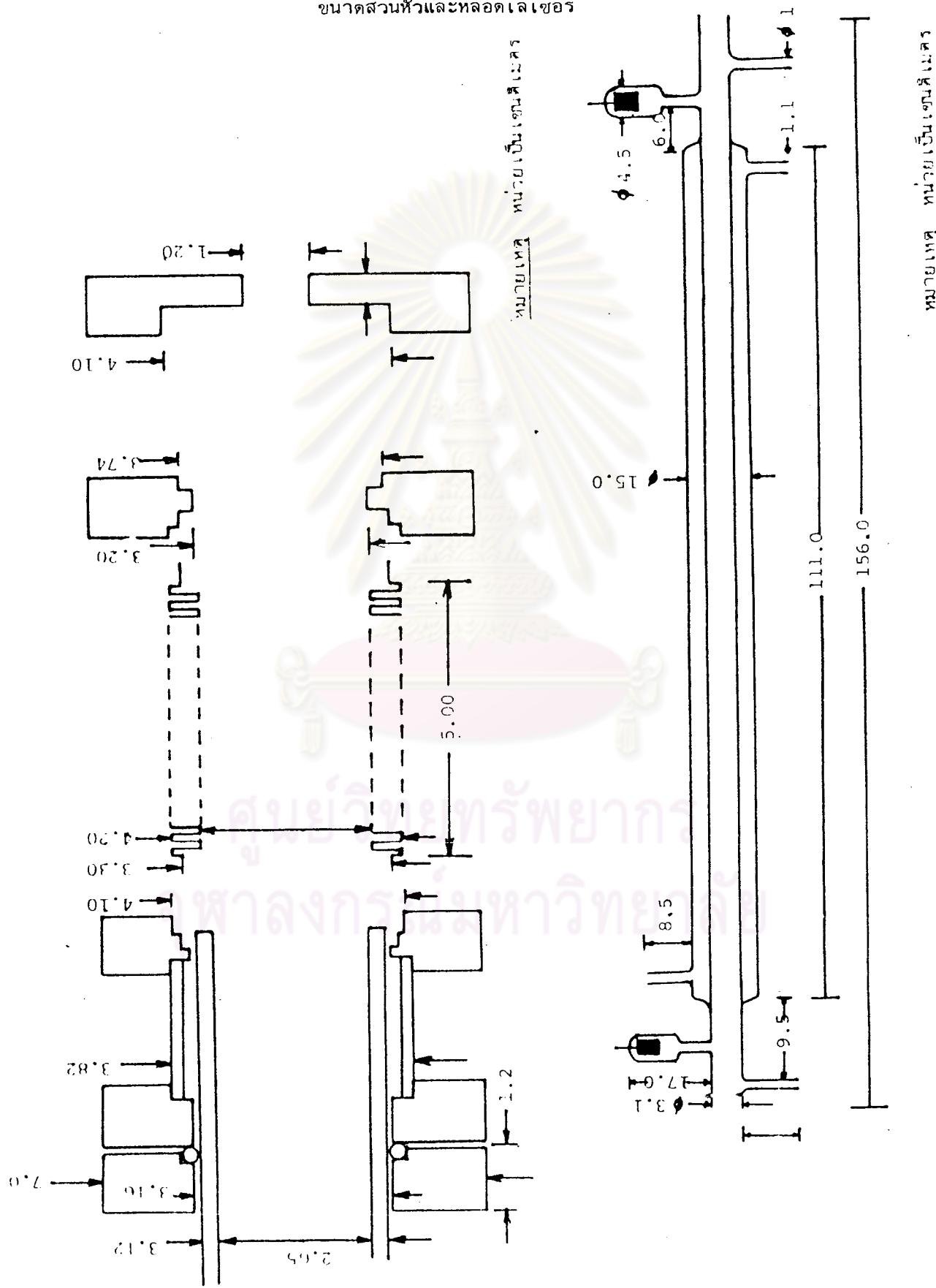
นอกจากนี้คุณลักษณะของเลเซอร์ยังขึ้นอยู่กับค่า Q (Quality factor) ของเลเซอร์ ซึ่งมีสมการดังนี้

$$Q = \frac{w \times \text{พลังงานที่สะสมใน Resonant cavity}}{\text{พลังงานที่สูญเสียไป}}$$

การที่เลเซอร์จะเกิดการ Lasing ได้นั้นค่า Q ของเลเซอร์จะต้องมีค่าสูงกว่าค่า หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Threshold condition ขึ้นกับระบบเลเซอร์แต่ละระบบที่ต้องการ

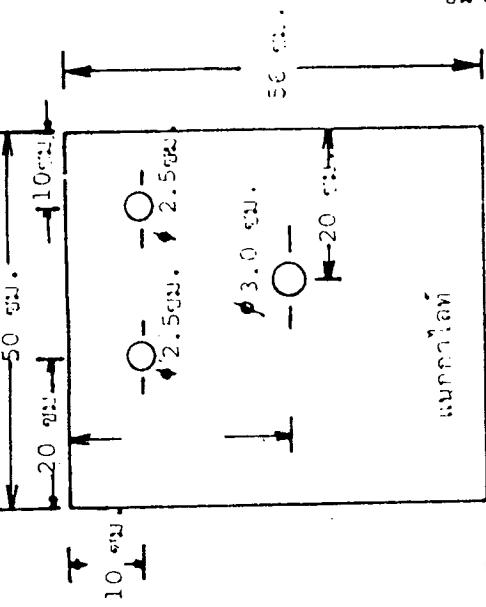
ภาคผนวก ข.

ขนาดส่วนหัวและหลอดเลือด

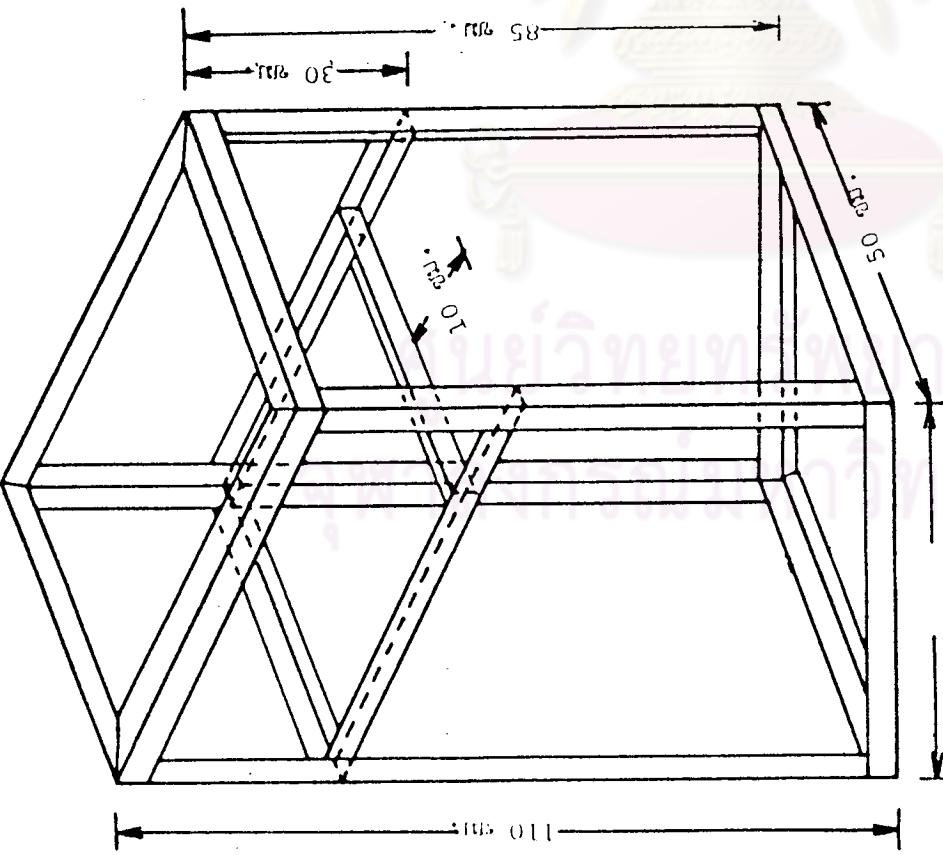
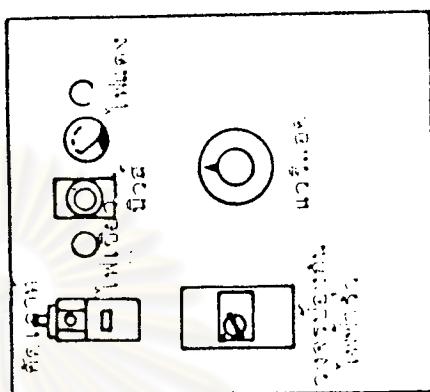


ภาคผนวก ๓.

ขนาดตู้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำ



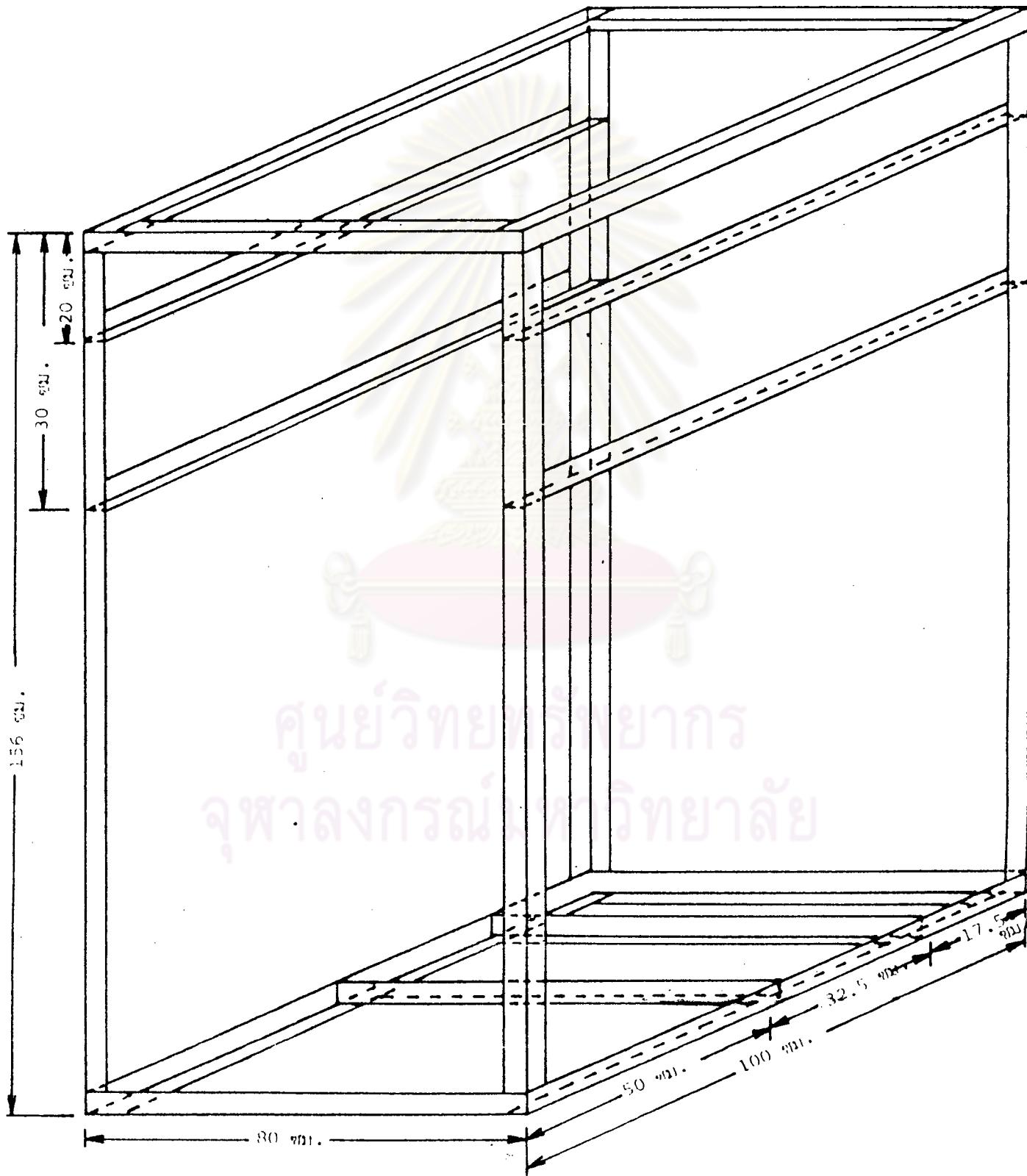
รายละเอียดของตู้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำ



รายละเอียดของโครงสร้างตู้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำ

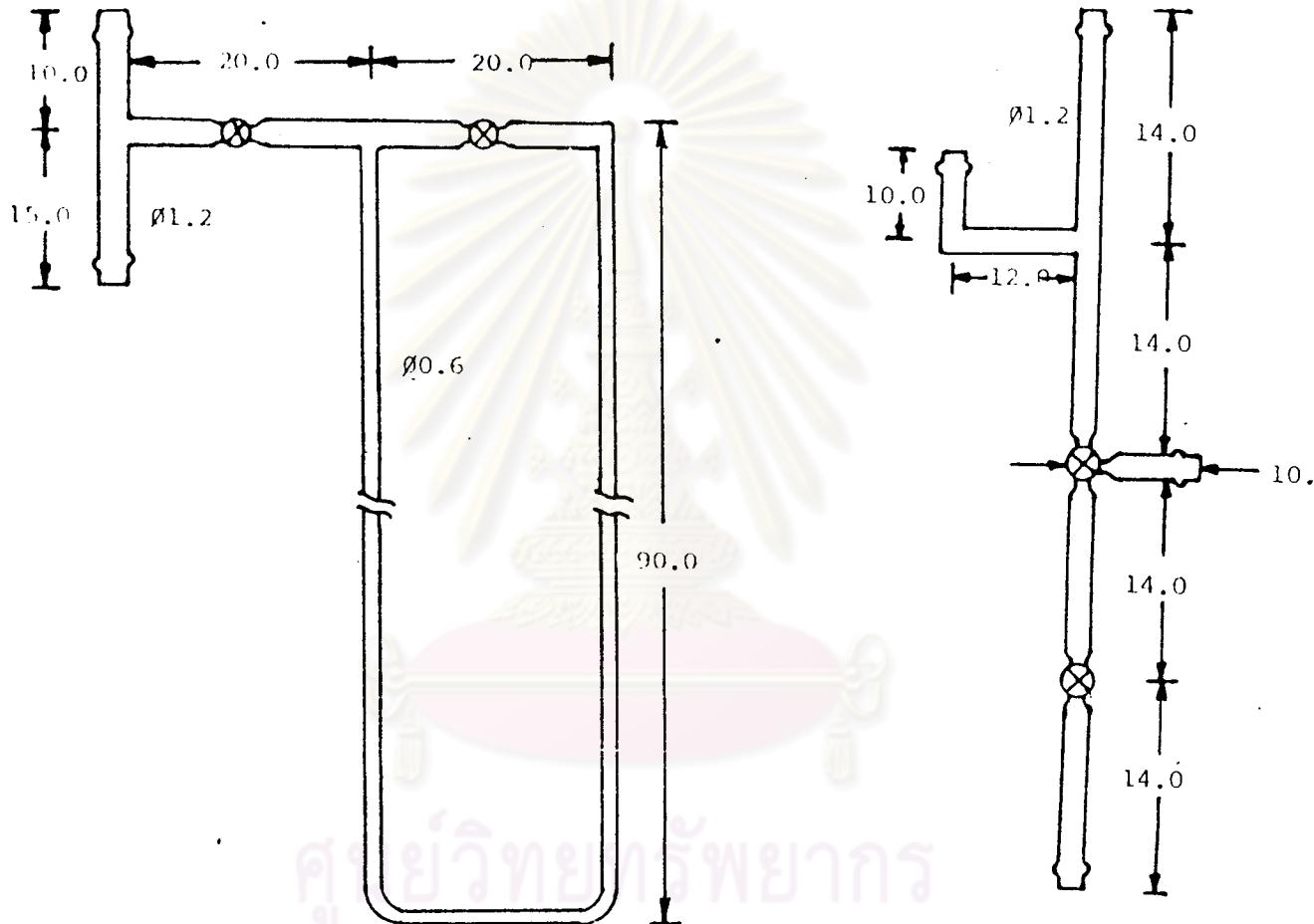
ภาคผนวก ง.

ขนาดตู้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงเคสื่อนสูง



ภาคผนวก จ.

ขนาดบาร์โอมิเตอร์ปอร์ตและห้องแก๊สชุดวัดที่แรงดึงดูดปั๊มสูญญากาศ

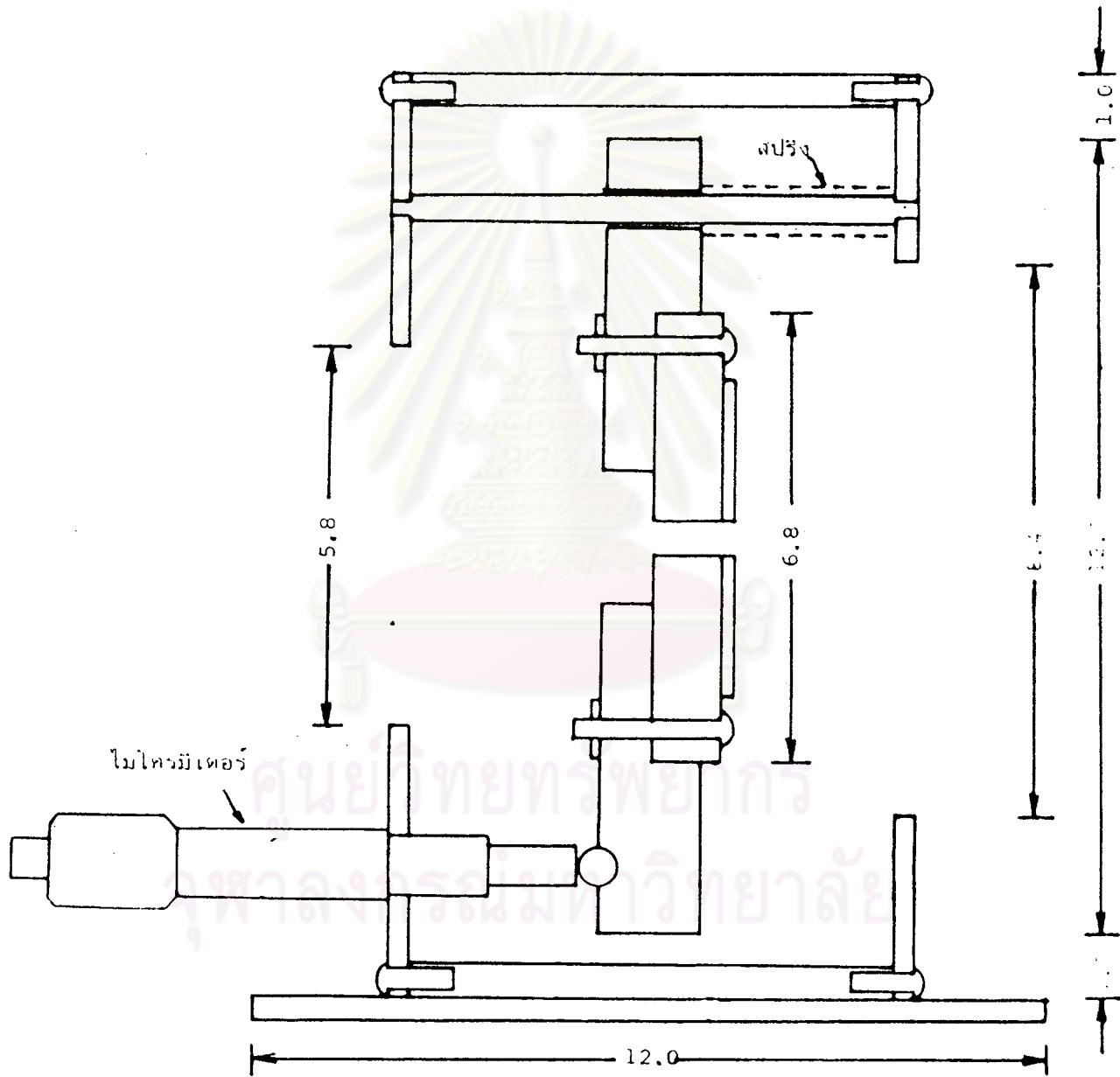


ศูนย์วิทยาลัยพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนรามคำแหง หน้าหอ gereen เก็บตัว

ภาคผนวก ย

ขนาดขอกกระจากเครื่องแบบหล่อต่อเนื่อง



หมายเหตุ หน่วยเป็นเซนติเมตร

ภาคผนวก ช.

การคำนวณประสิทธิภาพของหลอดเลเซอร์

เมื่อ P = กำลังเอาท์พุทของแสงเลเซอร์ที่รัดด้วยเทอร์โนมส์พูเพริล์ (รัตต์)

I = กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดเลเซอร์ (แอมป์)

V = แรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่อ่านได้จากโวลท์มิเตอร์ (โวลท์)

R = ความต้านทานที่จำกัดกระแส (กิโลโอห์ม)

eff = ประสิทธิภาพของหลอดเลเซอร์ (%)

$$\text{โดย } eff = \frac{P}{IV - I^2R} \times 100 \%$$

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ๗.

การคำนวณพลังงานของแสงเลเซอร์แบบคิว-สวิทช-

เมื่อ P = กำลังเอาท์พุทของแสงเลเซอร์ที่ตั้งกรอบ (วัตต์)

t = ระยะเวลาในการแอนนีล (วินาที)

A = พื้นที่ๆ ฉาบแสงเลเซอร์แบบคิว-สวิทช (ตารางเซนติเมตร)

E = พลังงานของแสงเลเซอร์แบบคิว-สวิทช ที่ตั้งกรอบ/พื้นที่ฉาบแสง (จูล/ตารางเซนติเมตร)

$$\text{โดย } E = \frac{P \times t}{A} \quad (\text{จูล/ตารางเซนติเมตร})$$

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ณ.

ตารางแสดงแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างปลายทิ้งสองข่อง เทอร์โมศพเพริล์ชเนิด J ที่อุณหภูมิ

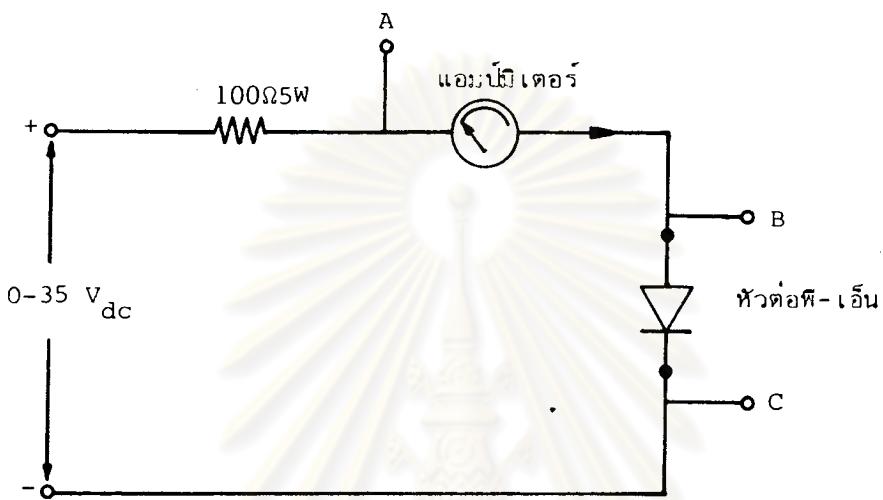
ต่างๆ



ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ญ.

วงจรและวิธีการรัดคุณสมบัติกระแส-แรงเกลื่อนไฟฟ้าของหัวต่อที่ใช้ในการทดลอง
เพื่อให้วัดค่ากระแส-แรงเกลื่อนไฟฟ้าให้ถูกต้องที่ค่ากระแสไฟฟ้าต่ำๆ



การอ่านค่า

กระแส I ที่ไหลผ่านหัวต่อพี-เอ็น อ่านได้จากแอมป์เมเตอร์โดยตรง

แรงเกลื่อนไฟฟ้าที่คร่อมหัวต่อพี-เอ็น (V_{BC}) หาได้จาก

$$V_{BC} = V_{AC} - V_{AB}$$

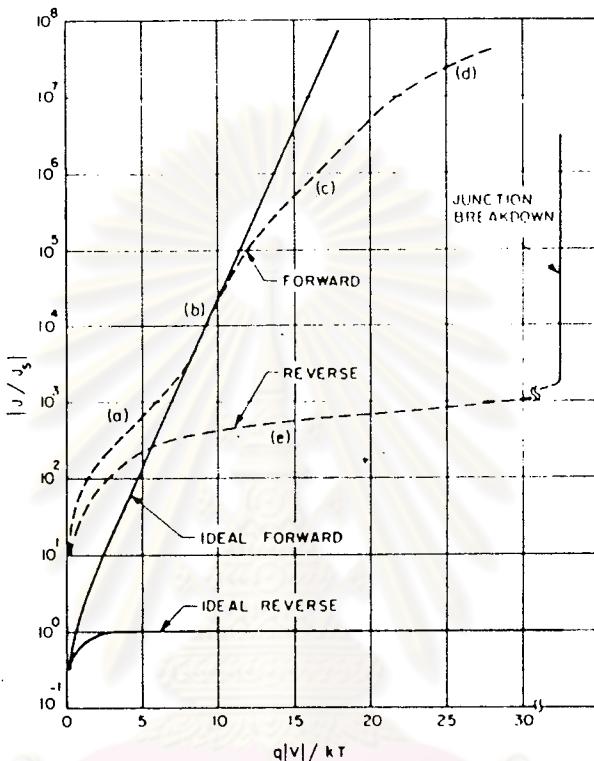
เมื่อ V_{AC} = แรงเกลื่อนไฟฟ้าที่ดักคร่อมแอมป์เมเตอร์กับหัวต่อพี-เอ็น ขณะกระแสไฟฟ้า I ไหลผ่าน

V_{AB} = แรงเกลื่อนไฟฟ้าที่ดักคร่อมแอมป์เมเตอร์ ขณะกระแสไฟฟ้า I ไหลผ่าน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ภ.

การคำนวณความต้านทานอนุกรมของหัวต่อ



Current-voltage characteristics of a practical Si diode

- (a) generation-recombination current region
- (b) diffusion current region
- (c) high-injection region
- (d) series resistance effect
- (e) reverse leakage current due to generation-recombination and surface effect.

เมื่อ I = กระแสที่ไหลผ่านหัวต่อปี-เอ็น เมื่อไบแอสตรง (แอมเปอร์)

V_1 = แรงดันไฟฟ้าที่ต่อกลางหัวต่อปี-เอ็น เมื่อไบแอสตรง ขณะมีกระแส ไหลผ่าน (โวลต์)

V_2 = แรงดันไฟฟ้าที่ต่อกลางหัวต่อปี-เอ็น แบบไอเดียล เมื่อไบแอสตรงขณะมีกระแส ไหลผ่าน
= (โวลต์)

R_s = ความต้านทานอนุกรมของหัวต่อ (โอห์ม)

$$\text{โดย } R_s = \frac{V_1 - V_2}{I}$$

ประวัติผู้เขียน

นายธนา แดงพวงไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2500 ณ กรุงเทพมหานคร
 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เมื่อปี พ.ศ.2523 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาบัญชี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา-
 ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในขณะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ
 ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 8 สถาบัน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ.2525 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผลงานที่เสนอต่อที่ประชุม เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย